

【公報種別】 特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】 第 3 部門第 4 区分
【発行日】 平成 17 年 12 月 22 日 (2005.12.22)

【公表番号】 特表 2002-501121(P2002-501121A)
【公表日】 平成 14 年 1 月 15 日 (2002.1.15)
【出願番号】 特願 2000-528374(P2000-528374)
【国際特許分類第 7 版】
C 2 3 C 4/00
B 0 5 B 7/20
【F I】
C 2 3 C 4/00
B 0 5 B 7/20

【手続補正書】
【提出日】 平成 17 年 1 月 19 日 (2005.1.19)
【手続補正 1】
【補正対象書類名】 明細書
【補正対象項目名】 請求項 4
【補正方法】 変更
【補正の内容】

【請求項 4】 連通導管（４）が十分に大きい直径を有して、導管（４）の内壁に粉体が接着して導管を塞ぐことを防止し、それにより前記導管（４）を進行する圧力波が、その中にある全ての粉体を流体化させるのに十分な圧力を有するが、デトネーションに利用できるエネルギーおよび連続粉体供給システム（７）を損なうことなく投与チャンバー（２）に達することを特徴とする請求項 1～3 のいずれかに記載のデトネーション・スプレー・ガンの粉体注入システム。

【手続補正 2】
【補正対象書類名】 明細書
【補正対象項目名】 0 0 0 8
【補正方法】 変更
【補正の内容】
【0 0 0 8】

デトネーションは不連続的なプロセスであり、したがって不連続な粉体供給を必要とする。市販の粉体供給装置は連続供給を与え、それらを高速またはプラズマスプレー技術に適したものとする。